下水道法等に基づく事業場等の排除基準 その１（処理困難物質以外）

単位(温度、pHを除きｍｇ/Ｌ)

No	項　目		公共下水道（終末処理場有）を使用する者			備考
			特定事業場（下水道法）		特定事業場以外	
			５０ｍ^3/日以上	５０ｍ^3/日未満		
1	温度(℃)		４５未満	４５未満	４５未満	
2	水素イオン濃度(pH)		５を超え９未満	５を超え９未満	５を超え９未満	
3	生物化学的酸素要求量(BOD)		６００未満	６００未満	６００未満	
4	浮遊物質量(SS)		６００未満	６００未満	６００未満	
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	５以下	５以下	５以下	
		動植物油脂類	３０以下	３０以下	３０以下	
6	沃素消費量		２２０未満	２２０未満	２２０未満	

下水道法等に基づく事業場等の排除基準 その２（処理困難物質）

単位(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を除きｍｇ/Ｌ)

No	項　目	公共下水道（終末処理場有）を使用する者			備考
		特定事業場（下水道法）		特定事業場以外	
		５０ｍ^3/日以上	５０ｍ^3/日未満		
7	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	３８０未満	３８０未満	３８０未満	
8	ニッケル含有量	１以下	１以下	１以下	横出し基準
9	カドミウム及びその化合物	０．０３以下	０．０３以下	０．０３以下	
10	シアン化合物	１以下	１以下	１以下	
11	有機燐化合物	０．２以下	０．２以下	０．２以下	上乗せ基準
12	鉛及びその化合物	０．１以下	０．１以下	０．１以下	
13	六価クロム化合物	０．２以下	０．２以下	０．２以下	
14	砒素及びその化合物	０．１以下	０．１以下	０．１以下	
15	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	０．００５以下	０．００５以下	０．００５以下	
16	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	
17	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	０．００３以下	０．００３以下	０．００３以下	
18	トリクロロエチレン	０．１以下	０．１以下	０．１以下	
19	テトラクロロエチレン	０．１以下	０．１以下	０．１以下	
20	ジクロロメタン	０．２以下	０．２以下	０．２以下	
21	四塩化炭素	０．０２以下	０．０２以下	０．０２以下	
22	1,2－ジクロロエタン	０．０４以下	０．０４以下	０．０４以下	
23	1,1－ジクロロエチレン	１以下	１以下	１以下	
24	シス－1,2－ジクロロエチレン	０．４以下	０．４以下	０．４以下	
25	1,1,1－トリクロロエタン	３以下	３以下	３以下	
26	1,1,2－トリクロロエタン	０．０６以下	０．０６以下	０．０６以下	
27	1,3－ジクロロプロペン	０．０２以下	０．０２以下	０．０２以下	
28	チウラム	０．０６以下	０．０６以下	０．０６以下	
29	シマジン	０．０３以下	０．０３以下	０．０３以下	
30	チオベンカルブ	０．２以下	０．２以下	０．２以下	
31	ベンゼン	０．１以下	０．１以下	０．１以下	
32	セレン及びその化合物	０．１以下	０．１以下	０．１以下	
33	ほう素及びその化合物	１０以下	１０以下	１０以下	
34	ふっ素及びその化合物	８以下	８以下	８以下	
35	1,4-ジオキサン	０．５以下	０．５以下	０．５以下	
36	フェノール類	０．５以下	０．５以下	０．５以下	上乗せ基準
37	銅及びその化合物	３以下	３以下	３以下	
38	亜鉛及びその化合物	２以下	２以下	２以下	
39	鉄及びその化合物(溶解性)	１０以下	１０以下	１０以下	
40	マンガン及びその化合物(溶解性)	１以下	１以下	１以下	上乗せ基準
41	クロム及びその化合物	２以下	２以下	２以下	
42	ダイオキシン類	１０pg-TEQ/L以下	１０pg-TEQ/L以下	１０pg-TEQ/L以下	

① 一定の要件に該当する場合、排除基準が適用されないことや、一定期間、排除基準の適用が猶予されることがあります。

② No.7,13,33,34,38の項目については、業種等により、暫定基準が適用される場合があります。

③ ［　　］は、次の特定事業場に係る直罰適用の排除基準になります。

・No.42の項目については、水質基準対象施設（ダイオキシン類対策特別措置法）を設置する特定事業場

・No.42以外の項目については、特定施設（水質汚濁防止法）を設置する特定事業場